Gerald Gerlach Wolfram Dötzel

Einführung in die Mikrosystemtechnik

Ein Kursbuch für Studierende

mit 169 Bildern, 49 Beispielen sowie 54 Aufgaben

Fachbuchverlag Leipzig im Carl Hanser Verlag

Inhaltsverzeichnis

| 1 | Einfüh | rung | 13 | |
|-----|-------------------------------------|---|----|--|
| 1.1 | Was ist | Was ist ein Mikrosystem? | | |
| 1.2 | Mikroe | Mikroelektronik und Mikrosystemtechnik | | |
| 1.3 | Anwen | dungsfelder und Entwicklungstrends | 22 | |
| 1.4 | Beispiel Drehratensensor | | 23 | |
| | 1.4.1 | Aufbau und Funktion | 24 | |
| | 1.4.2 | Funktionskomponenten und -elemente | 26 | |
| 2 | Skalier | rung und Ähnlichkeit | 31 | |
| 2.1 | Skalieru | ung | 31 | |
| 2.2 | Ähnlich | nkeit und Kennzahlen | 37 | |
| 3 | | toffe | | |
| 3.1 | | cht | | |
| 3.2 | Einkristallines Silizium | | | |
| | 3.2.1 | Beschreibung der Orientierung von Flächen und Richtungen im K | | |
| | 3.2.2 | Oberflächeneigenschaften bei verschiedener Orientierung | 55 | |
| | 3.2.3 | Anisotrope elastische Eigenschaften | | |
| | 3.2.4 | Festigkeit | | |
| | 3.2.5 | Siliziumscheiben | 63 | |
| 3.3 | Gläser | | 67 | |
| | 3.3.1 | Allgemeine Eigenschaften von Glas | 68 | |
| | 3.3.2 | Viskoelastisches Verhalten | 69 | |
| | 3.3.3 | Gläser in der Mikrosystemtechnik | 71 | |
| 3.4 | Polymere | | | |
| | 3.4.1 | Thermoplastische Werkstoffe in der Mikrosystemtechnik | 74 | |
| | 3.4.2 | Fotoresist | 77 | |
| 3.5 | Dünnschichten | | | |
| | 3.5.1 | Siliziumoxid, Siliziumnitrid | 82 | |
| | 3.5.2 | Elektrisch leitende Schichten | 84 | |
| | 3.5.3 | Polysiliziumschichten | 84 | |
| 3.6 | Materialeigenschaften im Vergleich8 | | | |

| 4 | Mikrot | technische Fertigungsverfahren | 88 |
|-----|--|--|-----|
| 4.1 | Überbli | ick | 88 |
| 4.2 | Reinheit in der Fertigung | | |
| | 4.2.1 | Reinraumtechnik | 95 |
| | 4.2.2 | Waferreinigung | 99 |
| 4.3 | Lithografie | | |
| | 4.3.1 | Prinzip | |
| | 4.3.2 | Lithografischer Prozess | |
| | 4.3.3 | Minimal strukturierbare Linienbreiten | |
| | 4.3.4 | Doppelseitenlithografie | 106 |
| | 4.3.5 | Lithografie in stark profilierten Strukturen | |
| 4.4 | Schichtherstellung | | 107 |
| | 4.4.1 | Überblick | |
| | 4.4.2 | Schichtkonformität | 109 |
| | 4.4.3 | Thermische Oxidation | 109 |
| | 4.4.4 | Aufdampfen | 111 |
| | 4.4.5 | Sputtern | |
| | 4.4.6 | Chemische Gasphasenabscheidung | |
| | 4.4.7 | Vergleich | |
| 4.5 | Schichtstrukturierung | | |
| | 4.5.1 | Grundlagen | 118 |
| | 4.5.2 | Nassätzen | 120 |
| | 4.5.3 | Trockenätzen | 120 |
| | 4.5.4 | Lift-off-Prozess | 123 |
| 4.6 | Anisotropes nasschemisches Tiefenätzen | | 123 |
| | 4.6.1 | Prinzip | 124 |
| | 4.6.2 | Anisotrope Ätzlösungen | |
| | 4.6.3 | Ätzraten | 126 |
| | 4.6.4 | Ätzstoppverfahren | 129 |
| | 4.6.5 | Ätzfiguren | 131 |
| | 4.6.6 | Entwurf von Ätzmasken | 140 |
| 4.7 | Dotierung | | 142 |
| | 4.7.1 | Diffusion | 142 |
| | 4.7.2 | Ionenimplantation | 146 |
| | 4.7.3 | Vergleich der Dotierungsverfahren | 148 |
| 4.8 | Verbindungsverfahren | | 149 |
| | 4.8.1 | Eutektisches Bonden | |
| | 4.8.2 | Anodisches Bonden | |
| | 4.8.3 | Siliziumdirektbonden | |

| | 4.8.4 | Vergleich der Verbindungsverfahren | 152 |
|------|---|---|-----|
| 4.9 | Isolation | nstechniken | 153 |
| | 4.9.1 | SIMOX-Verfahren | 154 |
| | 4.9.2 | BESOI-Verfahren | |
| | 4.9.3 | Smart-Cut-Verfahren | 157 |
| 4.10 | Oberflächenmikromechanik | | 158 |
| | 4.10.1 | Prinzip | 158 |
| | 4.10.2 | Herstellung von Hohlräumen | 161 |
| | 4.10.3 | Haften beweglicher Strukturen | 164 |
| | 4.10.4 | Vergleich von Volumen- und Oberflächenmikromechanik | 167 |
| 4.11 | Oberflächennahe Mikromechanik | | 167 |
| | 4.11.1 | Prinzip | 168 |
| | 4.11.2 | Verfahren | 168 |
| 4.12 | HARMS | ST | 171 |
| | 4.12.1 | Begriffsbestimmung | 171 |
| | 4.12.2 | LIGA-Verfahren | |
| 4.13 | Miniatu | risierte klassische Verfahren | 173 |
| | 4.13.1 | Mikrospritzgießen | 175 |
| | 4.13.2 | Mikroheißprägen | 178 |
| | 4.13.3 | Mikrozerspanen | 179 |
| 4.14 | Auswah | l von mikrotechnischen Fertigungsverfahren | 182 |
| 5 | Aufbau | - und Verbindungstechnik | 190 |
| 5.1 | | en und Anforderungen | |
| | 5.1.1 | Aufgaben | |
| | 5.1.2 | Zuverlässigkeitsgerechtes Packaging | |
| 5.2 | Funktionen der Aufbau- und Verbindungstechnik | | |
| | 5.2.1 | Mechanische Verbindungen | |
| | 5.2.2 | Elektrische Verbindungen | |
| | 5.2.3 | Wärmeabführung | |
| | 5.2.4 | Verkapselung und Gehäusung | |
| 6 | Funktio | ons- und Formelemente der Mikrosystemtechnik | 200 |
| 6.1 | Mechanische Elemente | | |
| V.1 | 6.1.1 | Empfindlichkeit in Nutzrichtung | |
| | 6.1.2 | Querempfindlichkeit | |
| | 6.1.3 | Eigenfrequenz | |
| | 6.1.4 | Dämpfung | |
| | 6.1.5 | Güte | |
| | 0.1.5 | UUL | |

| | 6.1.6 | Amplitudengang | 218 |
|-----|---------|--|-----|
| | 6.1.7 | Spannung an der Einspannstelle | |
| 6.2 | Fluidis | sche Elemente | 224 |
| | 6.2.1 | Kennzahlen und Modellsysteme | 224 |
| | 6.2.2 | Elementtypen | 228 |
| | 6.2.3 | Fluidische Schnittstellen | |
| | 6.2.4 | Entwurf mikrofluidischer Elemente und Komponenten | 231 |
| 6.3 | Therm | ische Elemente | |
| | 6.3.1 | Thermisch-elektrische Analogien | 237 |
| | 6.3.2 | Grundgleichungen für den Wärmetransport | |
| | 6.3.3 | Ersatzschaltungen | |
| 7 | Sensor | ren und Aktoren | 250 |
| 7.1 | Umkeh | nrbare und parametrische Wandler | 251 |
| | 7.1.1 | Umkehrbare Wandler | |
| | 7.1.2 | Parametrische Wandler | |
| | 7.1.3 | Stationäre umkehrbare Wandler | |
| 7.2 | Wandle | er für Sensoren und Aktoren | |
| | 7.2.1 | Elektrostatische Wandler | |
| | 7.2.2 | Piezoelektrische Wandler | |
| | 7.2.3 | Elektrodynamische Wandler | |
| | 7.2.4 | Thermomechanische Wandler | |
| | 7.2.5 | Piezoresistive Wandler | |
| 8 | Entwu | rf von Mikrosystemen | 306 |
| 8.1 | | fsmethoden und Werkzeuge | |
| 8.2 | | e mit konzentrierten Parametern | |
| | 8.2.1 | Verhaltensbeschreibung elektromechanischer Systeme | |
| | 8.2.2 | Analyse des statischen Verhaltens elektromechanischer Systeme | |
| | 8.2.3 | Analyse elektromechanischer Systeme bei harmonischen Lasten | |
| | 8.2.4 | Transiente Analyse elektromechanischer Systeme | |
| 8.3 | Systeme | e mit verteilten Parametern | 324 |
| | 8.3.1 | Verhaltensbeschreibung mittels analytischer Modelle | |
| | 8.3.2 | Numerische Methoden auf der Basis der Finiten-Elemente-Methode | 327 |
| | 8.3.3 | Makromodellierung komplexer Systeme durch Ordnungsreduktion | 329 |
| 9 | Einflus | s technologischer Prozesse auf Mikrosystemeigenschaften | 338 |
| 9.1 | | terbasierter Mikrosystementwurf | |
| 9.2 | | er Mikrosystementwurf | |

| Anhang A Physikalische Konstanten | |
|---|-----|
| Anhang B Koordinatentransformation | 352 |
| B.1 Elastische Koeffizienten | 353 |
| B.2 Piezoresistive Koeffizienten | |
| Anhang C Eigenschaften von Siliziumoxid- und Siliziumnitrid-Schichten | 359 |
| Anhang D Nomenklatur von Dünnschichtprozessen | 361 |
| Anhang E Haftung bei oberflächen-mikromechanischen Strukturen | 364 |
| E.1 Kapillarkräfte | 364 |
| E.2 Kritische Länge von Biegefedern | |
| Symbolverzeichnis | 367 |
| Abkürzungsverzeichnis | 375 |
| Stichwortverzeichnis | 380 |